

# 超高真空排気装置

## UHVPS

### ■ 概要

ARIOSでは各種超高真空排気装置の製作を承っています。

本装置はメインチャンバーに試料交換用のハッチを搭載しており、各種プラズマ源、加熱機構、蒸着源、ガス供給系など各種のコンポーネントを組み合わせ、多様な実験にご使用頂けます。

### ■ 特徴

1. クリーンな真空をベースに、成膜やエッチングなど多くの実験に使用できます。
2. コンパクトチャンバー + シンプルな構成により、メンテナンスが容易に行えます。
3. 最小限の構成、完全手動タイプにより低価格です。
4. 各種オプションの搭載によりカスタマイズが可能です。

### ■ 仕様

項目	内容
チャンバー	SUS304製（内面鏡面仕上げ、電解研磨処理）
ロードロックハッチ	SUS304製 オリング式
ターボ分子ポンプ	排気速度：260～355L/sec（N <sub>2</sub> 、保護金網付き）Pfeiffer社製 又は、 排気速度：220～350L/sec（N <sub>2</sub> 、保護金網付き）大阪真空機器製作所製 制御電源：デジタルコントロールによる監視・保護機能搭載
ロータリーポンプ	排気速度：250L/min 電動機出力：0.45kW
チャンバー到達圧力	1×10 <sup>-4</sup> Pa 以下（チャンバー内の負荷がない状態）
リーク量	6.7×10 <sup>-11</sup> Pa・m <sup>3</sup> /sec 以下
真空計	コンパクトフルレンジCCゲージ
本体架台	キャスター、アジャスター付
用力	電源：単相 200V/15A（最大） 圧縮空気：圧力；0.4～0.6MPa 接続径：Rc1/4
寸法、重量	本体（500mm×600mm H1100mm）、約60kg

### □ オプション

- 基板加熱機構
- 基板上下機構
- ロードロック機構
- 各種プラズマ源
- 加熱機構
- 蒸着源
- ガス供給系各種

超高真空排気装置

排気セット

MBE装置

マイクロ波プラズマ  
実験装置RFプラズマ  
実験装置単結晶ダイヤモンド  
合成用CVD装置ダイヤモンド合成用  
HF-CVD装置

小型スパッタ装置

